瑞典Q-Sense

石英晶体微天平分析仪

研究薄膜或涂层与空气或液体的吸附和反应，全自动液体处理系统对多种不同类型表面的分子相互作用和分子吸附进行研究。获得薄膜或涂层的质量、反应动力学、刚性、弹性模量、粘性模量、薄膜厚度和密度

★频率范围：0.1-70MHz
★质量分辨率：0.177ng/cm^3(5MHz晶体)
★阻抗(R)分辨率：0.01ohm
★损耗(D)分辨率：1×10^{-9}

芬兰PICOSUN

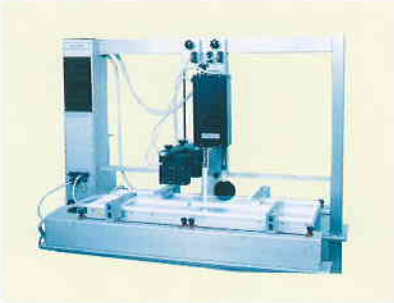
ALD原子层沉积系统

将物质以单原子膜形式镀在基底表面,可用于纳米结构均匀镀膜、光电子材料器件、介电层微电子机械系统、嵌入式电容等

★晶片尺寸:2-6"50-150 mm
★晶片数：25-50片
★工艺温度：至500℃
★载气：99.999 % N2 / Ar
★设计紧凑、处理能力强
尖端的反应器设计
全套完善售后服务

芬兰KSV

Lb膜交替镀膜仪



漂浮的单分子或Langmuir膜能沉积到固体表面形成高度有序的多分子层

★最大基片尺寸：100×100mm
★镀膜速率：1-85mm/min
2-170mm/min
★滞后时间：0-9999秒可调
★臂的最大行程：145mm
★镀膜机电机：伺服直流电机
★亚相容积0.75 0.95 5.5L
★亚相温控：-20-100℃

三个系统：膜天平、LB膜分析仪、交替多层LB膜分析仪。

美国NEOCERA

PED/PLD薄膜制备系统

脉冲电子束和脉冲激光沉积镀膜系统。可在靶材表面产生最高达108W/cm2的高能量密度。PLD系统的激光束的入射角为45°，保持了激光密度在靶材上的最大均匀性薄膜：金属、绝缘体、半导体、生物兼容材料、超导材料压电、磁性材料等。

PED应用脉冲电子束快速蒸发靶材，在基片上形成与靶材组成相同的薄膜。可在短时间内在靶材表面产生很大的功率密度。

芬兰KSV

表面张力仪

研究液体的表面和界面性质液体和固体间的界面，测量表面、面、界面张力、动态接触角、临界胶束浓度，液体的粘着性、材料溶解、润滑性、吸附等满足ASTMD971和IEC60422

★测量范围：0.001-2000mN/m
★标准探头分辨率:0.001mN/m
★最大样品重量：210g
★重量分辨率：0.01mg
★力的分辨率:0.1uN
★接触角范围：0-180°
★接触角分辨率：0.01°
★位移分辨率：0.01um

芬兰KSV

光学接触角仪

光学数字成像液滴形状分析系统自动确定表面/界面张力、接触角、吸附和表面自由能、CMC、液滴形态尺寸、界面流变性能。

★测量范围：0-180°
0.01-2000mN/m
★精确度±0.1° ±0.01mN/m
★CCD：相机放大倍数0.7-4.5
★光源：LED红外冷光源背景
★九种表面自由能计算模块
★光学标准样品：用于悬滴和座滴校准
★符合ISO9001:2000